酸と光を用いたアリールケイ素およびアリールゲルマニウム化合物の協働的結合開裂反応

(東大院総合文化) ○丁 涵清・正井 宏・岩井 智弘・寺尾 潤

Cooperative Bond Cleavage Reactions of Arylsilicon and Arylgermanium Compounds with Acid and Light (*Graduate School of Arts and Sciences, The University of Tokyo*) CHanqing Ding, Hiroshi Masai, Tomohiro Iwai, Jun Terao

We newly discovered that Si–C bonds in dipyrenylsilicon compounds were cooperatively cleaved by UV and acid, probably owing to the enhanced reactivity based on the β effect of dipyrenylsilicon compounds. In this study, we investigated cooperative reactivity of polycyclic aromatic compounds with group 14 elements by light and acid, and confirmed cooperative Si–C or Ge–C bond cleavage under the conditions with UV irradiation and HCl. Also, we verified the stability of the arylsilicon and arylgermanium compounds (1a, 1b) under the condition with light irradiation and acid respectively. In the reaction of depyreneylgermanium compound (1b), stronger UV intensity was required for high reactivity.

Keywords: Arylsilicon compoud; Arylgermanium compound; Bond Cleavage Reaction; Photoreaction; Polycyclic aromatic compound

最近我々は、光と酸の協働的な効果により、ジピレニルケイ素化合物における Si-C 結合が加速的に開裂することを見出した。その機構としては、ケイ素化合物の β カチオン安定化効果が反応の促進に関与していると考えられる。本研究では、ケイ素と同じく β 効果が期待できる 14 族元素を有する種々の多環式芳香族化合物に対し、光と酸による開裂反応性を調査した。その結果、ジピレニルケイ素化合物(1a)およびジピレニルゲルマニウム化合物(1b)は、光または酸の単独刺激では反応しない一方で、光と酸を同時に作用させた場合のみ Si-C 結合が開裂した(下図)。また、1b では高い反応性を得るためにより高い UV 強度が必要であった。